

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成23年1月27日(2011.1.27)

【公開番号】特開2008-160105(P2008-160105A)

【公開日】平成20年7月10日(2008.7.10)

【年通号数】公開・登録公報2008-027

【出願番号】特願2007-321888(P2007-321888)

【国際特許分類】

H 05 K 3/10 (2006.01)

B 41 J 29/46 (2006.01)

B 05 C 11/00 (2006.01)

【F I】

H 05 K 3/10 D

B 41 J 29/46 A

B 05 C 11/00

【手続補正書】

【提出日】平成22年12月8日(2010.12.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

印刷処理方向と各プリントヘッド上に1つ又はそれ以上のエゼクタを備えた1つ又はそれ以上のプリントヘッドとを有する印刷システムを用いて、基板上に印刷スポットで滑らかなマイクロスケール形状を形成する方法であって、

前記印刷スポットの半径を決定し、

試験パターンを生成し、

前記印刷システムで前記試験パターンを印刷し、

前記印刷された試験パターンを、液滴の拡がり及びラインの滑らかさに関して分析するステップ、

を含むことを特徴とする方法。

【請求項2】

前記印刷された試験パターンを分析するステップが、前記試験パターンの既知の位置について、

(a) ライン幅を表す性能指数を計算し、

(b) 粗さを表す性能指数値を計算し、

(c) 最適なライン幅と粗さが達成されたか否かを判定し、

(d) 前記粗さが許容できなければ、前記基板をポストベークするステップ、

を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。

【請求項3】

データ処理装置上で実行可能であり、且つ、印刷処理方向と各プリントヘッド上に1つ又はそれ以上のエゼクタを備えた1つ又はそれ以上のプリントヘッドとを有する印刷システムを用いて基板上に印刷スポットで滑らかなマイクロスケール形状を形成するために使用可能な、1組のプログラム命令を格納する記憶媒体であって、

スポット配置ピッチと前記印刷スポットの半径とを決定するための命令と、

試験パターンを生成するための命令と、

前記印刷システムで前記試験パターンを印刷するための命令と、
前記印刷された試験パターンを、液滴の拡がり及びラインの滑らかさについて分析する
ための命令と、
を含むことを特徴とする記憶媒体。

【請求項 4】

前記試験パターンは、スポット配置ピッチ及び隣接する液滴のタイミングにおける変動
を示す、様々なスポット配置のスポット特性の連続パターンを備える請求項 3 に記載の記
憶媒体。

【請求項 5】

前記 1 組のプログラム命令は、更に、滑らかなライン縁部の形状と狭いライン幅を生成
するための最適なスポット配置を決定するため、試験パターンの前記決定又は前記分析の
ためのアルゴリズムを備える請求項 3 に記載の記憶媒体。